半導体アレイ検出器 と光学系の組合せに よる高 S/N 比粉末 XRD 測定

High S/N Ratio Powder XRD Measurement by Combination of Semiconductor Array Detector and Optics

Key-words : Powder XRD, Monochromator, Semiconductor array detector, Energy resolution

上村 祐一郎

Yuichiro UEMURA (Spectris Co., Ltd. Malvern Panalytical division)

1. はじめに

X線回折(XRD)法は,結晶相の同定,結晶構造 解析,ラインプロファイル解析,応力,配向性の評価 等,さまざまな用途において広い分野で用いられてい る解析手法である.広い応用範囲にともない,測定方 法も高分解能測定,精密測定,多数試料測定,透過法 測定,微小部測定,微量試料測定等の多彩なニーズに 合わせた最適な光学系や検出器の選択によりX線の 検出感度を向上させる工夫がなされてきた.特に, 2000年代に入り,半導体アレイ検出器の登場により, 集中法測定に関しては高感度,高分解能を実現してき た¹⁾.

しかし、一般的に回折に使用する Ka線のような特 性 X線を選択する単色化に関しては、Kβフィルター により行うことが多く、その場合、測定材料から発生 した蛍光 X線に由来する大きなバックグラウンドノ イズを含んだ XRD プロファイルになることもある. そこで、X線光学系や検出器の進歩により、最近はあ らゆる元素種を含んだ材料に対しても S/N比の高いデー タを測定することが可能になってきた.本報告では、 エネルギー分解能の高い半導体アレイ検出器を集中法 測定用入射側光学系とともに用いた S/N比の高い測 定例を紹介する.

2. 半導体アレイ検出器の動作原理¹⁾

粉末サンプルに代表される多結晶試料の測定には, ブラッグ-ブレンターノ法による疑似集中光学系が最 も広く利用されており,その光学系を使用した測定法 を集中法と呼ぶことが多い.従来の集中法の場合,X 線管のターゲット,多結晶試料,受光スリットをロー ランド円上に配置する光学的条件をとり,試料は水平 配置のまま1次側(X線源)および2次側が同時に走 査を行う.このとき回折ビームは受光スリット位置で フォーカスを結び,強度が高く分解能が高い回折デー タを得ることができる.また,入射X線は角度に広 がりを持っており,配向が異なるより多くの結晶子が 回折に寄与していることも集中法の特徴である.

ここで図1に2次側(受光側)に半導体検出器を搭 載した場合の粉末(多結晶)試料測定時の光学系模式 図を示す.

半導体アレイ検出器内にはスキャン方向に分割され た半導体素子が並んでおり、通常100チャンネル(素 子)以上からなっている.また,近年では素子が二次 元配列した検出器も登場しているが、ここでは一次元 配列した素子を有する検出器について述べる. 各検出 素子は従来の受光スリット部分に位置し、集中法の光 学条件を満たすようになっている. 分割した検出素子 は単独のデータ同時取り込みを可能にし、スキャンの 過程で全検出素子が通過した20角度に対しチャンネ ル数積算した強度データを得る. すなわち. 図1下段 では、試料からの特定回折線について検出器の最上部 にある検出素子で検出を開始し、その後、検出器が 図1中段、上段へと連続的に移動する、図1上段のと おり検出器の最下部へ移動するまでの間は順次、検出 素子が回折線を検出する. つまり, 同じ回折線に対し て検出素子数積算を行っていることになる。勿論、異 なる結晶面からの回折線に関しても、異なる検出素子 が順次,連続的に積算し検出を行う.



図1 集中法測定での半導体アレイ検出器の動作原理

この結果,回折データをスキャン中,半導体アレイ 検出器は各反射について,より長い時間回折線を計数 することになり,最終的に全チャンネルで得られた強 度を積算するので,計数率の高い回折ピークを得るこ とができる.

3. 入射側光学系の効果

XRD 測定においては、さまざまな測定手法に応じた、 最適な光学系を使用する.特に X線源の後段にあた る1次側に用いる光学素子により、平行 X線ビーム、 単色化 X線ビーム、微小 X線ビームを生成すること ができる.近年では、平板多層膜ミラーの回折により、 Kα線に単色化された集中光学系ビームを形成するよ うな光学系が用いられている²⁾.このように単色化す る光学素子をモノクロメーターと呼んでおり、1次側 に設置するモノクロメーターを入射側モノクロメーター と呼んでいる.入射側モノクロメーターにより、X線 源である X線管球から発生する連続 X線や Kβ線な どの Kα線以外のエネルギーをほぼ低減し、X線のエ ネルギー幅を制限することができる.

入射側モノクロメーターを用いることで,低角度に おいて連続 X 線による散乱を低減することができ, その結果,低角度になるにつれて起こるバックグラウ ンド強度の増加を抑えることができる.また,Ka線 以外の波長による照射で蛍光 X 線が励起する元素(Ni や Cu など)が存在する物質の場合,入射側モノクロメー ターを用いると蛍光 X 線によるバックグラウンドノ イズが低減された X 線回折プロファイルを得ること ができる.

4. 検出器のエネルギー分解能

X線が検出器に入射し,さらに検出器から出力され る信号は電圧パルスに変換され,増幅されたのちに波 高分析器へと出力される^{3),4)}.検出器から出力される 信号には,X線回折で用いる,特性X線のKα線(Kα₁, Kα₂) 由来のパルスだけでなく,Kβ線や連続X線, 試料から励起によって発生した蛍光X線などの信号 も含まれる.波高分析器は,検出器から出力されたパ ルスをエネルギー(波高)ごとに選別し,不要なパル ス信号を電気的に除去する.

時間経過に伴い出力されるパルスの波高とパルス数 の頻度分布を波高分布曲線と呼び,パルス数はX線 強度に比例する. Cu-Ka線をX線源に用いた場合の, 時間経過に伴うパルスと波高分布曲線の関係を図2に 示す. Cu-Ka線と蛍光X線の関係を単純に考えるた めに,X線源からの連続X線や装置由来のノイズな a) エネルギー分解能が高い場合



図2 波高分布曲線と検出器パルス

時間

パルス数

どの情報は含まないものとする. ここでは波高が高い Cu-Ka線と波高の低い蛍光 X線のパルスが観測され ていることが分かる. 通常, 波高に範囲を設け, 検出 されるパルス(測定パルス)を設定する. 波高(エネ ルギー)の範囲について, エネルギー上限値を U. L. (Upper Limit), エネルギー下限値を L. L. (Lower Limit) とする.

検出器によって,特性 X 線の波高のばらつきの大 小があり,そのばらつきにより波高分布曲線の線幅が 変わる.波高のばらつきを検出器のエネルギー分解能 といい,波高分布曲線の線幅が狭くなるにつれエネル ギー分解能は高くなる.逆にエネルギー分解能が低い 場合は線幅が広くなり,Cu-Ka線の場合,エネルギー が近い蛍光 X 線の分布と重なりが大きくなりやすい (図2b).その場合,測定パルスのエネルギー下限値 を Cu-Ka線曲線裾付近に設定してしまうと,低エネ ルギー側に存在する蛍光 X 線のパルスも計測してし まう.すなわち,蛍光 X 線のエネルギーを検出する ことになり,バックグラウンドノイズを拾ってしまう ことになる.

一方,波高のばらつきの少ない,エネルギー分解能 の高い検出器の場合は,Cu-Ka線の分布曲線と蛍光 X線の分布曲線との重なりが小さくなる(図2a).し たがって,測定パルスのエネルギー下限値をCu-Ka 線曲線裾付近に設定しても蛍光X線のエネルギーと の分離が良いため、蛍光 X 線のエネルギーを受光す ることが少ない.このことから、X 線照射によって蛍 光 X 線が発生させる化合物に対してもエネルギー分 解能の高い検出器を用いて測定を行うと、蛍光 X 線 からのバックグラウンドノイズの少ない XRD プロファ イルを得ることができる.

5. 金属酸化物の測定例

最後に,遷移金属を含んだ金属をモノクロメーター とエネルギー分解能の高い半導体検出器を用いた Cu-KαX線回折測定例を何点か示す.

入射側にモノクロメーター光学系,受光側に半導体 アレイ検出器を配置した状態で,NIST標準試料であ る鉄鉱石試料(Iron Ore)を測定した. 図3の上段部 分に,半導体アレイ検出器のエネルギー幅を制限した 場合とそうでない場合を比較した XRD プロファイル を示す.鉄鉱石の主成分である Fe は,Cu-Kα線エネ ルギーにより励起され蛍光 X線が発生する.したがっ て,エネルギー分解能が高い検出器を用いた場合,検 出器のエネルギー幅を最適に制限することにより,蛍 光 X線由来のバックグラウンド強度を大幅に低減で きることが分かる.

また,バックグラウンド強度を低減するだけでなく, 強度がランダムなノイズも低減されることにより, 微弱な回折ピークもはっきりと観測することができる. 鉄鉱石標準試料には少量のカオリナイト(Kaolinite), 石英(Quartz)および針鉄鉱(Goethite)が含有し ている.四角で囲んだ部分である20=45-48°に, QuartzおよびGoethiteのピークが存在するが,検出



図3 半導体アレイ検出器のエネルギー幅制限有無の比較 NIST 鉄鉱石試料の測定結果

器のエネルギー幅に制限を設けていない場合は, 試料 に含まれる鉄由来の蛍光 X 線によるバックグラウン ドにこれらの回折ピークが埋もれてしまい, 確認する ことができない(図3下段 a).しかし, エネルギー 幅を制限して測定した結果, ノイズが低減し, P/B 比が向上することによりこれらの回折ピークをはっき りと確認することができた(図3下段 b).これらの 結果より, 蛍光 X 線エネルギーを検出器により低減 することにより, 検出限界が大幅に下がる効果がある ことがわかった.

次にリチウムイオン電池の正極材料について述べる. リチウムイオン電池の正極は充電時にリチウムイオン を放出し,放電時にリチウムイオンを吸蔵することで 電極として働く.リチウムイオン電池の正極はリチウ ムイオンの吸蔵,放出に直接関与する活物質などで構 成され,正極活物質としてコバルト酸リチウムが主に 使用されている.コバルト酸リチウムは層状構造を有 し,その層間にリチウムイオンが挿入,脱挿入される ことで正極活物質として働く.ただし,コバルトはレ アメタルであり,低コスト化やさらなる高容量化を図 るため、コバルトをニッケルやマンガンなどの遷移元 素で置換した活物質も開発されている.

LiMO₂(M=Mn, Co, Ni) で表される正極活物質は 遷移金属で構成されるため, Cu対陰極 X 線源の照射 で蛍光 X 線が発生する. その遷移金属の内, Ni は連 続 X 線により蛍光 X 線が発生するため, 低バックグ ラウンド X 線回折プロファイルを得るには入射側で モノクロメーターを用いた方が良い. 図4に入射側に モノクロメーターを使用した場合とそうでない場合の LiMO₂ 試料測定データの比較を示す. 入射側モノク ロメーターを用いて測定した場合は, バックグラウン ドが全体的に低くなっていることが分かる.

リチウム電池正極活物質の遷移金属の内, Mn および Co は Cu-Kα 照射により蛍光 X 線が発生する. その場合は検出器のエネルギー幅, 特に低エネルギー側



図4 入射側モノクロメーター有無の比較(縦軸ルート表示)



図5 アレイ検出器の各エネルギー範囲でのリチウムイオン 電池の正極活物質の測定結果

を狭く設定し、 蛍光 X 線エネルギーを低減すること が望ましい. 図5は半導体アレイ検出器のエネルギー 幅の低エネルギー側の値を変化させた場合のリチウム 電池正極活物質の XRD プロファイルを示す. Cu-Ka のエネルギーである 8.05 keV より低エネルギー側が 蛍光 X 線のエネルギーであるが、検出器のエネルギー 範囲を狭くするほど、 蛍光 X 線由来のバックグラウ ンドが低くなっていることが分かる. もちろん前述の 通り、バックグラウンドが下がるにつれ S/N 比も向 上し、微弱ピークがより観測しやすくなることが期待 できる.

6. おわりに

近年,粉末X線回折におけるさまざまな解析方法 が進化・発展し,精度の高い解析結果が要求されるようになってきている.そのためには,質の高いXRD プロファイルの取得が不可欠である.S/N比の高い XRD プロファイルを測定するためには,ここで述べ た通り最適な光学系および検出器の選択と設定が非常 に重要である.

謝 辞 本原稿の執筆の機会を太陽誘電株式会社 波多野桂 一氏より頂きました.この場を借りて深く感謝の意を表します.

文 献

- 1) 山路 功, 三宅まり子, 赤井孝夫, 材料の科学と工学, **49**[2], 57-65 (2002).
- 2) 中井 泉,泉富士夫, "粉末 X 線解析の実際"第3版,朝 倉書店 (2021) pp.20.
- 3) 中井 泉, "蛍光 X 線分析の実際"第2版, 朝倉書店 (2016) pp.52-54.
- 4) 加藤誠軌, "X 線回折分析", 内田老鶴圃 (1990) pp.142.

筆者紹介

上村 祐一郎(うえむら ゆういちろう)

1999 年から太平洋セメント株式会社中央研究所勤務. 2003 年より現職. [連絡先] 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 スペクトリス株式会社